

# 复连通二维电子系统电阻 量子化的理论解释\*

彭建平 周世勋

复旦大学物理系, 上海, 200433

1989 年 11 月 17 日收到

本文论证, 单连通的二维电子体系, 在低温、强磁场等条件下, 其两端电阻精确地等于量子化霍耳电阻  $h/fe^2$ ,  $f$  为 Landau 填充因数. 并以此为基础, 解释了复连通二维电子系统的电阻量子化.

PACC: 7220; 7340M; 7215G

自从整数量子化霍耳效应 (IQHE)<sup>[1]</sup> 和分数量子化霍耳效应 (FQHE)<sup>[2]</sup> 被发现以来, 二维电子气在强磁场下的量子输运特性引起人们浓厚兴趣<sup>[3,4,7,8]</sup>. Fang 和 Stiles 的实验<sup>[3,4]</sup>证明了下列事实: (1) 当 QHE 发生时, 二维电子气内部没损耗, 损耗只发生在电流进入或渗出的交界线附近; (2) 对于单连通体系, 源-漏两端电阻精确地等于量子化霍耳电阻值, 跟电子气的形状和尺寸无关; (3) 对于多连通体系, 两端电阻等于  $(i/j)h/e^2$ , 根据不同的连接方法,  $i, j$  分别具有不同的整数值.

Fang 和 Stiles 用一个唯象模型解释了(3)<sup>[4]</sup>. 他们的模型如图 1 所示, 对于开放的处于量子霍耳区的二维电子系统, 电极分别接在边缘上. 电极  $m$  处于电压  $V_m$ , 并有电流  $I_m$  注入电子系统, 按顺时针或者逆时针给电极编号, 当相邻电极满足条件

$$\frac{V_{m+1} - V_m}{I_m} = \frac{h}{fe^2} = R_0 \quad (1)$$

时, 式中  $f$  为 Landau 填充因数, 按电极的连接方式取边界条件, 例如, 当  $V_k = V_l$  时, 有  $I_k = -I_l$  等, 任何两端电阻  $R_{ab} = (V_b - V_a)/I_a$  均可精确求出. 本文将直接以单连通体系的二端电阻量子化为基础, 根据电极的具体连接方式, 用电路网络理论来解释这一现象.

如图 2 所示, 二维电子系统在加垂直方向的强磁场后, Landau 填充因数为  $f$ , 源极和漏极的电压分别为  $V_s, V_d$ , 当通以电流  $I$  时, 上端电压  $V_u$  和下端电压  $V_l$  在发生量子化霍耳效应时应满足

$$\frac{V_u - V_l}{I} = \frac{h}{fe^2} \quad (2)$$

\* 国家自然科学基金和国家高等教育委员会基金资助的课题.

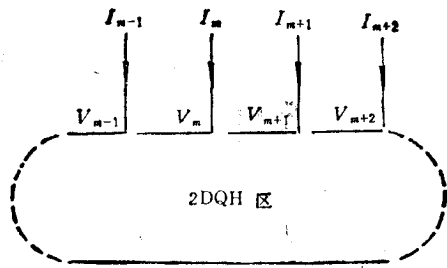


图1 处于量子霍尔区,带有多个边缘电极的二维电子气模型,

$$\frac{V_{m+1} - V_m}{I_m} = \frac{h}{fe^2} = R_Q$$

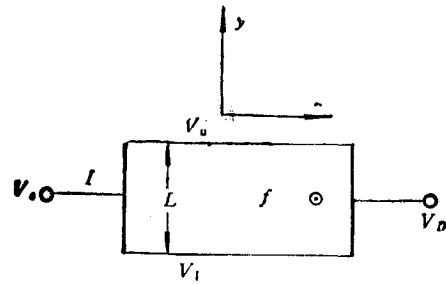


图2 单连通的霍尔电桥

这里  $f$  为 IQHE 或 FQHE. 在电子系统内部, 电流穿过时无损耗, 损耗只发生在有电子系统与源极或漏极的交界线上. 所以, 只需考虑交界线上的情况.

二维电子气在低温下与强磁场相互作用, 电子在二维空间分布不再均匀, 电子的分布概率形成点阵, 与此相辅相成而存在有 vortex 点阵, 平均地讲,  $f$  个电子对应一个基本磁通量子 ( $h/e$ )<sup>[6]</sup>. 至于源和漏这样的粒子库, 其填充因数可认为很大 ( $f \rightarrow \infty$ ). 把电子穿过界面看成一种“隧道穿透”, 则当一个电子在位置  $y$  穿过交界线时, 相当产生了  $1/f$  个 vortex, 产生的 vortex 朝上或朝下运动, (具体方向由电流和磁场的取向决定). 这样, 在交界线的两侧, 源与电子体系的电势差  $\Delta V(y)$  必须满足 Josephson 关系<sup>[9]</sup>:

$$\frac{d\Delta\varphi(y)}{dt} = \frac{e}{\hbar} \Delta V(y). \quad (3)$$

当一个 vortex 穿过时, 产生的位相滑移 (phase slippage) 为  $2\pi$ , 这样, 在源极附近,  $\Delta V(y)$  就可决定

$$\Delta V(y) = \frac{h}{fe^2} \int_y^L J(y) dy. \quad (4)$$

式中  $J(y)$  为线电流密度,  $L$  为交界线的长度.

取上端和下端两个积分限, 可得

$$V_s = V_u; \quad (5a)$$

$$\frac{V_s - V_l}{I} = \frac{h}{fe^2}. \quad (5b)$$

同样的分析可知, 电子由系统内部流入漏极时, 对应于 vortex 消失, vortex 在交界线上运动方向正好与前面相反, 在漏极附近

$$\Delta V(y) = \frac{h}{fe^2} \int_0^y J(y) dy, \quad (6)$$

取上端和下端两个积分限, 得

$$V_l = V_d; \quad (7a)$$

$$\frac{V_u - V_d}{I} = \frac{h}{fe^2}. \quad (7b)$$

由方程 (5b), (7b) 得

$$\frac{V_s - V_d}{I} = \frac{h}{fe^2} \quad (8)$$

即源-漏之间的电压总是量子化的, 其电阻值严格等于量子化霍耳电阻, 这正是实验<sup>[3]</sup>中所观察到的。另外, 由 5(a), 7(a) 可知, 交界线的一端总是没有电压降, 这也被实验所证实。这说明 vortex 在描述电子气在强磁场下的量子传输现象中起着至关重要的作用。关于更普遍情形下的两端电阻量子化, 在另文中有详细讨论<sup>[7]</sup>。

Fang 和 Stiles 的实验<sup>[4]</sup>用六端霍耳电桥, 样品的迁移率超过  $10^4 \text{ cm}^2/\text{vs}$ , 所以加上强磁场后能观察到量子化霍耳效应, 当电极以不同的方式连接时 (图 3 (a)), 在两圆圈之间的电阻, 以  $R_Q = h/fe^2$  为单位, 分别等于 3, 2, 3/2, 1, 2/3, 1/2, 1/3, 其精度可达到百万分之几, 且结果跟形状和尺寸无关。

把复连通的电子体系分解成单连通电子体系的串联和并联。具体作法如下: 在用导线连接起来的两端点之间作等势线 (图 3 中 *f* 用虚线表示)。由于沿此线不存在霍耳效应, 说明等势线附近电子气的性质与两维体系内部电子气的性质不相同, 所以可以把此线看成交界线, 交界线附近的区域, 等效于具有恒定电势, 其行为与源、漏相同的粒子库。当电流穿过交界线时, (5) 和 (7) 式同样适用。以图 3 (a) 中 *a* 为例, 复连通的导线在电子气内部产生两个交界区域, 等效于把电子气分成三个串联起来的单连通区域, 见图 3 (b) 中 *a*。因单个单连通区域的两端电阻为  $R_Q$ , 所以, 总的电阻值为  $3R_Q$ 。同样的分析可把图 3 (a) 的各种情形等效地示于图 3 (b), 显然, 结果与模型 (1) 和实验完全相同。

最后, 还需指出, 此模型只考虑理想情形 ( $\rho_{xx} = 0$ )。当发生量子化霍耳效应时, 如果  $\rho_{xx}$  不是严格等于零, 那么电阻值将会偏离严格的量子化值。

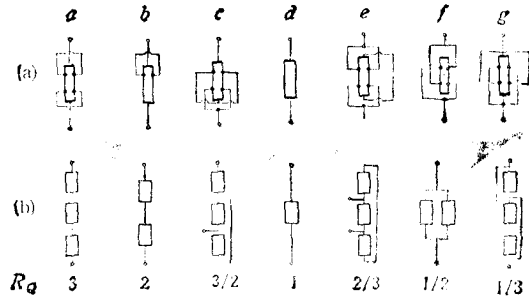


图 3 (a) 实验中采用的电极连接方式; (b) 转换成单连通电子气组成网络, 每块的两端电阻为

$$R_Q = \frac{h}{fe^2}$$

- [ 1 ] K. von Klitzing, G. Dorda and M. Pepper, *Phys. Rev. Lett.*, **45**(1980), 494.
- [ 2 ] D. C. Tsui, H. L. Stormer and A. C. Gossard, *Phys. Rev. Lett.*, **48**(1982), 1559.
- [ 3 ] F. F. Fang and P. J. Stiles, *Phys. Rev.*, **B27**(1983), 6487.
- [ 4 ] F. F. Fang and P. J. Stiles, *Phys. Rev.*, **B29**(1984), 3749.
- [ 5 ] P. W. Anderson, *Rev. Mod. Phys.*, **38**(1966), 298.
- [ 6 ] J. P. Peng, *Phys. Lett.*, **A129**(1988), 124; *Phys. Lett.*, **A129**(1988), 127.
- [ 7 ] Jian-ping Peng and Shi-xun Zhou, to be published in *Phys. Rev.*, B.
- [ 8 ] D. A. Syphers and P. J. Stiles *Phys. Rev.*, **B32**(1985), 6620.

EXPLANATION OF THE QUANTIZED MAGNETORESISTANCE IN MULTIPLY CONNECTED PERIMETERS IN TWO-DIMENSIONAL ELECTRON SYSTEMS

PENG JIAN-PING    ZHOU SHI-XUN

*Department of Physics, Fudan University, Shanghai, 200433*

(Received 17 November 1989)

ABSTRACT

We explain the quantized magnetoresistance in multiply connected perimeters in two-dimensional systems observed by Fang and Stiles based in terms of a model which states that the two-terminal resistance of a two-dimensional electron system in a quantizing magnetic field in any open geometry is given by  $h/fe^2$ , where  $f$  is the Landau filling factor.

**PACC:** 7220; 7340M; 7215G